

# ECR スパッタ装置実験記録

実験者			
実験日時	年	月	日( )
実験目的およびコメント			
P.P no		dpt	
ターゲット材料		ターゲット基板間距離	
基板材料		基板温度	
バックグラウンド真空度			Torr
導入ガス	ガス種	流量	真空度
1 プラズマ発生装置			
	2		
製膜室			
製膜時真空度			Torr
マグネット電流			A
マイクロ波電力	進行	W	反射 W
基板電位	DC :	V	A
基板電力	RF :	W	
ターゲットバイアス		V	A